

ВЛИЯНИЕ БОМБАРДИРОВКИ ИОНАМИ Ar⁺ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК CdS

Ж.Ш. Содикжанов¹, Б.Е. Умирзаков², З.А. Исаханов¹,

Изучено влияние бомбардировки ионами Ar⁺ на состав, зонно-энергетические параметры и оптические свойства пленок CdS. Показано, что при низких дозах ионов Ar⁺ ($D \leq 5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$) поверхность обогащается атомами S, а при высоких дозах ($D \geq 5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$) атомами Cd.

INFLUENCE OF THE BOMBARDMENT OF THE Ar⁺ IONS ON ELECTRONIC AND OPTICAL CHARACTERISTICS OF THE CdS FILMS

J.Sh. Sodikjanov¹, B.E. Umirzakov², Z.A. Isakhanov¹

¹Institute of Ion-Plasma and Laser Technologie, Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Durmon yuli 33, 100125, Uzbekistan. Tel.: +99893-565-10-89; E-mail: za.isakhanov@gmail.com

²Tashkent State Technical University, University 2, 100095, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: ftmet@rambler.ru

The studied influence of the bombardment of the Ar⁺ ions on composition, zone-energy parameters and optical characteristics of the CdS films. It is shown that under low dose Ar⁺ ions ($D \leq 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$) surface is enriched with the S atoms, under the high doses ($D \geq 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$) with the Cd atoms.

В настоящее время хорошо изучено влияние лазерного отжига, прогрева, электронной бомбардировки и бомбардировки ионами O₂⁺ на оптические свойства пленок CdS [1 – 8]. В частности установлено, что наличие некоторого количества кислорода (до $\sim 10^{20} \text{ см}^3$) приводит к существенному изменению спектра фотолюминесценции и некоторому уменьшению ширины запрещенной зоны E_g пленки CdS. Изучено также влияние

1

бомбардировки ионами Ar⁺ и Ba⁺ на электронные свойства CdTe [9, 10]. В данной работе изучено влияние бомбардировки ионами Ar⁺ на состав, коэффициент преломления света и ширину запрещенной зоны CdS.

Объектами исследования являлись поликристаллические пленки CdS n - типа с толщиной $\sim 1 \text{ мкм}$, выращенных на поверхности SnO₂-стекло [2]. Исследования проводили с использованием методов ОЭС, ФЭС, ДБЭ путем измерения зависимости коэффициента пропускания света от энергии фотонов в интервале $h\nu = 0.6 – 3 \text{ эВ}$. Профили распределения атомов по глубине определяли методом ОЭС в сочетании с послойным травлением поверхности ионами Ar⁺ с $E_0 = 2 \text{ кэВ}$ под углом $5 – 10^\circ$ относительно поверхности образца. Поверхностная концентрация

Cd составляет $\sim 45 – 48 \text{ ат.\%}$, S $\sim 50 – 52 \text{ ат.\%}$, а кислорода 1 – 2 ат.\%. На рисунке 1 приведены зависимости коэффициента пропускания света K от энергии фотонов для CdS. K₀ – коэффициент пропускания света до бомбардировки, K_δ – после бомбардировки. В случае чистого CdS зависимость K(hv) в интервале $h\nu = 0.6 – 2.2 \text{ эВ}$ практически не меняется, в интервале 2.2 – 2.3 эВ экспоненциальна, а в интервале 2.3 – 2.4 эВ линейно (резко) уменьшается приближаясь к нулю. Экстраполяция этой части кривой к оси $h\nu$ равна 2.42 эВ, что дает оценочные значения E_g пленки CdS. При низких дозах облучения $D = 5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$ ионы Ar⁺ попадают на отдельные участки поверхности [10]. Средние размеры этих участков составляют $\sim 10 – 15 \text{ нм}$, а расстояние между центрами соседних участков $\sim 50 – 60 \text{ нм}$.

2

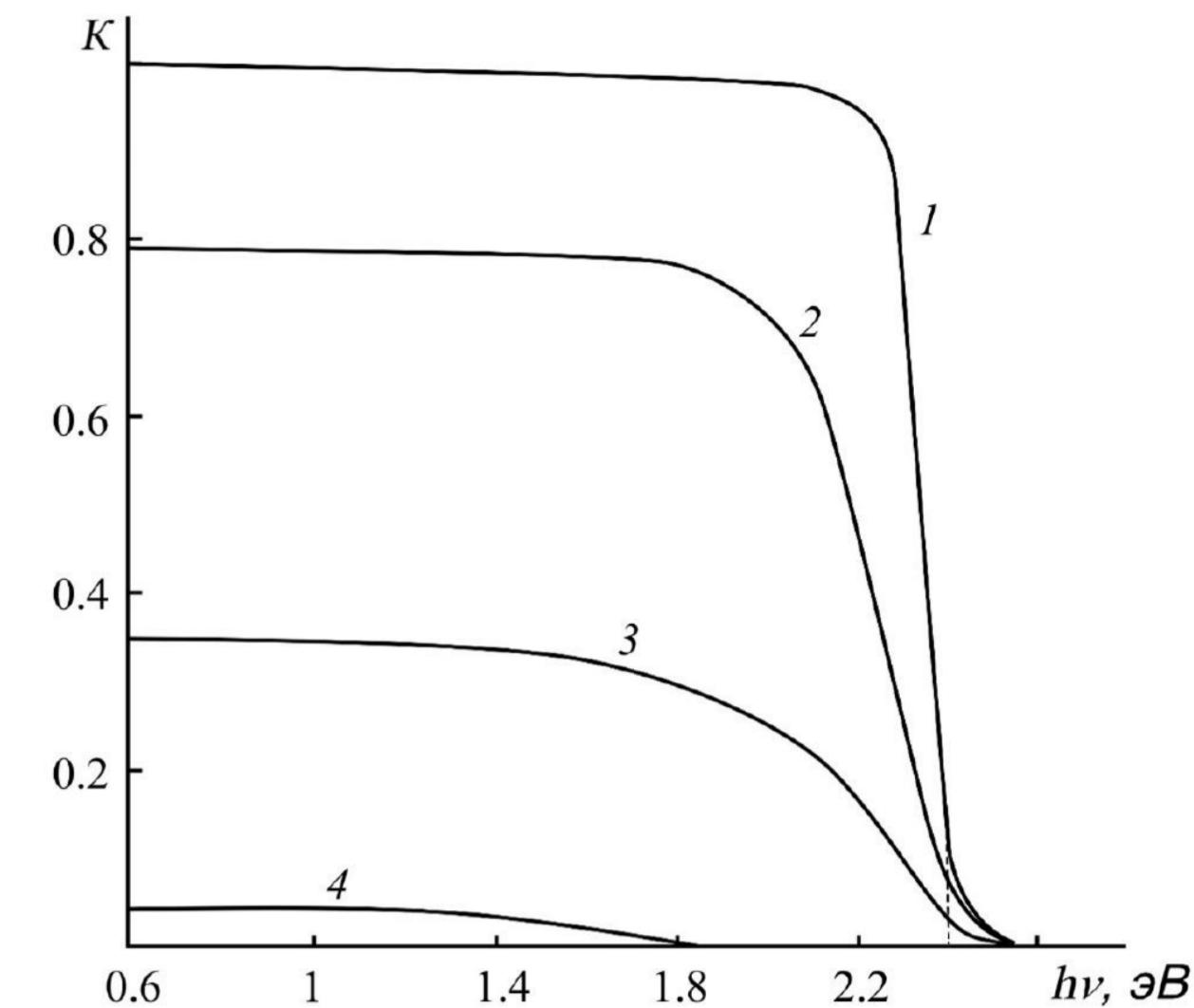


Рис. 1. Зависимости коэффициента пропускания света K от энергии фотонов для CdS, бомбардированного ионами Ar⁺ с $E_0 = 1 \text{ кэВ}$ при дозах D, см⁻²: 1 – 0 (чистый CdS), 2 – $5 \cdot 10^{14}$, 3 – $5 \cdot 10^{15}$, 4 – $6 \cdot 10^{16}$.

С ростом дозы ионов размеры бомбардированных участков увеличиваются. При $D = 5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ вся облученная поверхность полностью разупорядочивается, все молекулы CdS в ионобомбардированном слое разлагаются. K в зависимости от дозы можно оценить степень покрытия поверхности нанофазами по формуле

3

$$\theta = 1 - \frac{K_\delta}{K_0}$$

Результаты расчета для разных доз представлены на рис. 2 (кривая 1). Из рис. 2 видно, что при бомбардировке CdS ионами Ar⁺ зависимость C_{Cd}(D) проходит через минимум при $D = 10^{15} \text{ см}^{-2}$. В интервале $D = 10^{15} – 8 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ C_{Cd} почти линейно растет от 30 ат.\% до 80 – 85 ат.\%, а затем скорость роста замедляется и начиная с $D = 5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ концентрация Cd практически не меняется и устанавливается на уровне 80 – 85 ат.\%. Эти результаты показывают, что при низких дозах ионов Ar⁺ после разложения CdS на составляющие атомы S преимущественно диффундируют к поверхности и поверхность обогащается атомами серы.

На рис. 3 приведены профили распределения атомов S по глубине для CdS, бомбардированного ионами Ar⁺ с $E_0 = 1 \text{ кэВ}$ при $D = 6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$. Видно, что до глубины $d = 5 – 10 \text{ \AA}$ концентрация S заметно не меняется. В интервале $d = 10 – 30 \text{ \AA}$ зависимость C_S(d) почти линейно растет от 3 – 5 ат.\% до 40 – 42 ат.\%, а при $d > 35 – 40 \text{ \AA}$ практически не изменяется и стабилизируется на уровне 45 – 50 ат.\%.

Таким образом, зависимости коэффициента пропускания света пленки CdS при бомбардировке ионами Ar⁺ с $E_0 = 1 \text{ кэВ}$ при разных дозах показали, что с ростом дозы значение K в исследуемой области энергии фотонов ($h\nu = 0.6 – 3 \text{ эВ}$) монотонно уменьшается. До дозы $D = 5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ ширина запрещенной зоны практически не меняется. При $D \geq 10^{16} \text{ см}^{-2}$ границы соседних участков начинают перекрывать друг друга и коэффициент прохождения света и E_g

резко уменьшается. Оценены дозные зависимости коэффициента пропускания света и степень покрытия поверхности нанофазами.

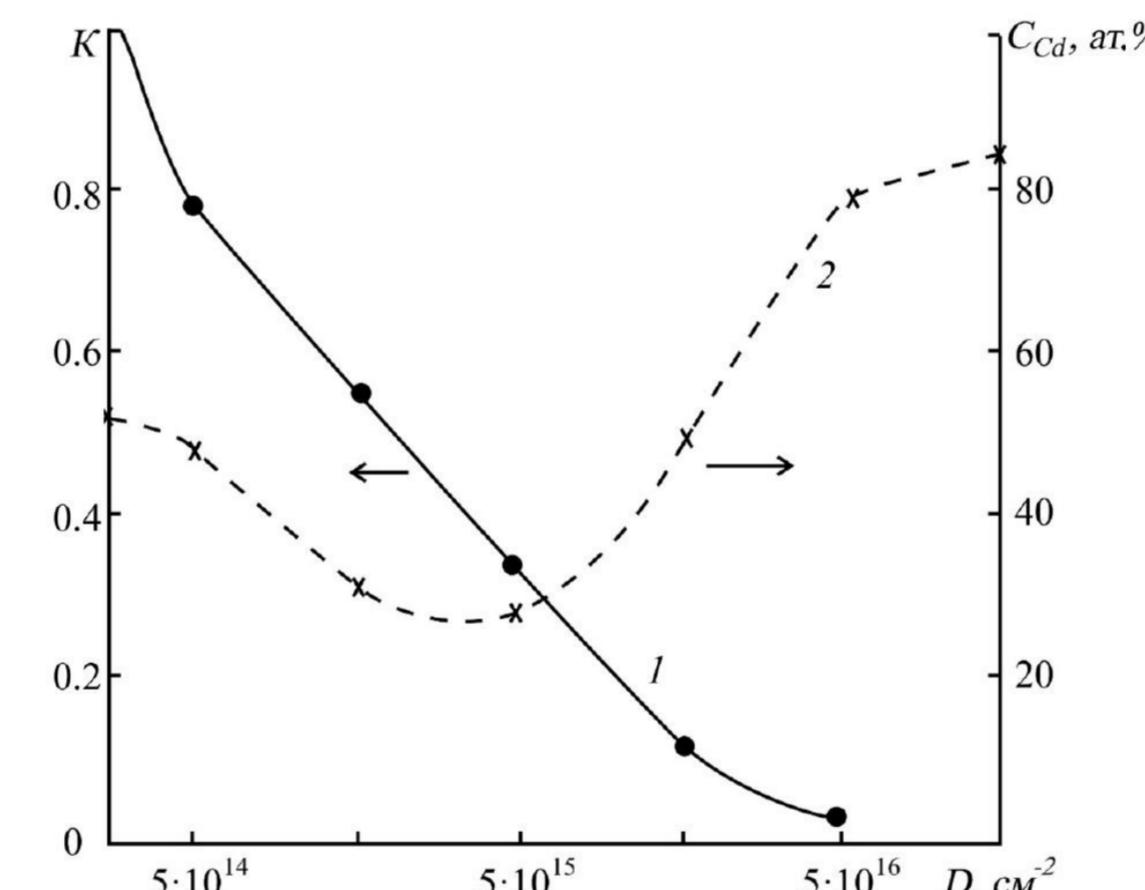


Рис. 2. Зависимости K (кривая 1) и поверхностной концентрации Cd (кривая 2) от дозы облучения для CdS, бомбардированного ионами Ar⁺ с $E_0 = 1 \text{ кэВ}$.

5

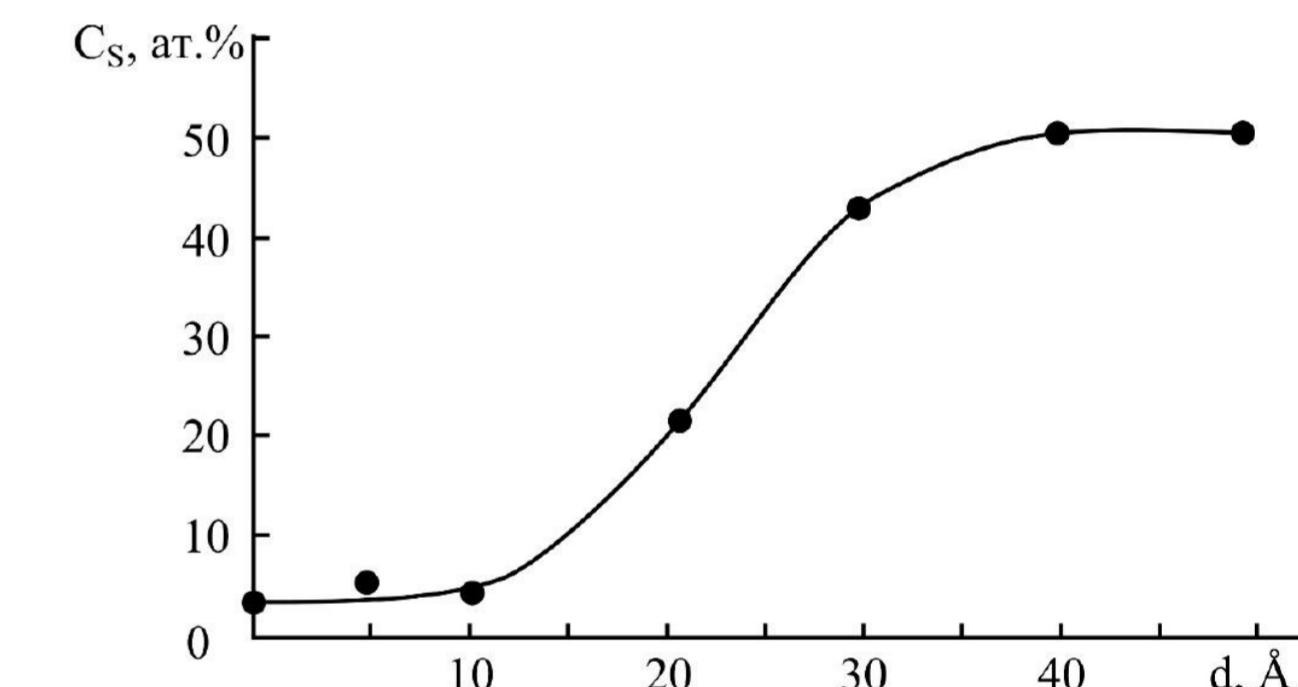


Рис. 3. Профили распределения S по глубине CdS, бомбардированного ионами Ar⁺ с $E_0 = 1 \text{ кэВ}$ при $D = 6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$.

ЛИТЕРАТУРА

- А.С. Ворох, С.З. Назарова, Н.С. Кожевникова, ФТТ **54** (6), 1228 (2012).
- Ж. Жанабергенов, Ш.А. Мирсагатов, С.Ж. Каражанов, Неорганические материалы **41**, 55 (2005).
- П.Н. Ткачук, ФТТ **42** (11), 1961 (2000).
- Н.К. Морозова, Н.Д. Даневич, А.А. Канакин Physica Status Solidi C **7** (6), 1501 (2010).
- V. Kumar, T.P. Sharma, Optical materials **10**, 253 (1998).
- Y.P. Venkata Subbiah, P. Prathap, K.T.R. Reddy, D. Mangalaraj, K. Kim, J. Yi, J. Phys. D: Appl. Phys. **40**, 3683 (2007).
- П.Н. Крылов, Э.А. Романов, И.В. Федотова, ФТП **45** (1), 127 (2011).
- Д.М. Седракян, П.Г. Петросян, Л.Н. Григорян, ЖТФ **85** (5), 94 (2015).
- Y.S. Ergashev, D.A. Tashmukhamedova, F.G. Djurabekova, B.E. Umirzakov, Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics **80** (2), 138 (2016).
- Z.E. Mukhtarov, Z.A. Isakhanov, B.E. Umirzakov, T. Kodirov, E.S. Ergashev, Technical Physics **60** (12) 1880 (2015).

6